

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2011 年 9 月 22 日(22.09.2011)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2011/115131 A1

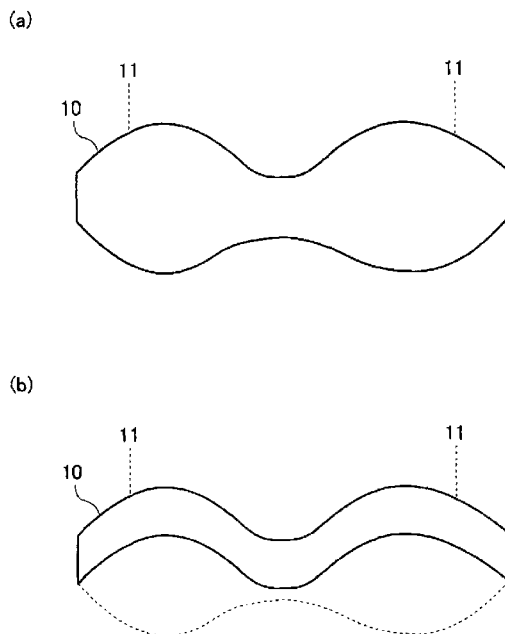
- (51) 国際特許分類:
H01L 21/027 (2006.01) *G03F 1/14* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/056096
- (22) 国際出願日: 2011 年 3 月 15 日(15.03.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-059199 2010 年 3 月 16 日(16.03.2010) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 旭硝子株式会社 (Asahi Glass Company, Limited.) [JP/JP]; 〒1008405 東京都千代田区有楽町一丁目 1 番 2 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 中西 博志 (NAKANISHI Hiroshi) [JP/JP]; 〒1008405 東京都千代田区有楽町一丁目 1 番 2 号 旭硝子株式会社内 Tokyo (JP). 生田 順亮 (IKUTA Yoshiaki) [JP/JP]; 〒1008405 東京都千代田区有楽町一丁目 1 番 2 号 旭硝子株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 小栗 昌平, 外 (OGURI Shohei et al.); 〒1050003 東京都港区西新橋一丁目 7 番 1 3 号 虎ノ門イーストビルディング 10 階 栄光特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]

(54) Title: OPTICAL MEMBER BASE MATERIAL FOR EUV LITHOGRAPHY, AND METHOD FOR PRODUCING SAME

(54) 発明の名称: EUVリソグラフィ光学部材用基材およびその製造方法

[図5]



(57) Abstract: Disclosed is a method for producing an optical member base material for EUV lithography which involves performing the following steps in the following order: a pre-polishing step for pre-polishing the surface, on which a film is to be formed, of a glass substrate and the rear surface in relation to the aforementioned surface, on which a film is to be formed; a measurement step for measuring the flatness and the maximum plate thickness distribution of the glass substrate; and a correction polishing step for locally polishing only the rear surface of the glass substrate on the basis of the measurement results obtained in the measurement step.

(57) 要約: 本発明は、ガラス基板の成膜面および該成膜面に対する裏面を予備研磨する予備研磨工程、ガラス基板の最大板厚分布と平坦度を測定する測定工程、前記測定工程での測定結果に基づいて前記ガラス基板の裏面のみを局所研磨する修正研磨工程、をこの順に実施して、EUVリソグラフィ光学部材用基材を得る、EUVリソグラフィ光学部材用基材の製造方法に関する。